

KOHエッチング装置

(型式:ETC-2001F/ETC-6001F)

SiCウエハやGaNウエハ等の熔融KOHによるエッチング処理を安全かつ精密に!!
基板カゴにウエハをセットし、エッチング開始ボタンを押すだけ

【本装置のメリット】

- ・装置が密閉されているため、処理中のKOH蒸気/溶液との接触・暴露の可能性がほとんどありません。
- ・エッチング時間を設定すれば、自動でエッチングが行われます。
- ・基板カゴが回転しているため、手動で攪拌する必要がありません。

【適用】

- ・ウエハ表面欠陥評価
- ・ウエハ表面処理

【仕様表】

型式	ETC-2001F	ETC-6001F
ルツボサイズ	Φ100×H90 (t2)	Φ200×H149 (t2)
対応ウエハサイズ	2インチ	6インチ
最高加熱温度(制御用熱電対値)	700℃	
温度安定性(制御用熱電対値)	±1℃	
基板カゴ上下機構	自動	
基板カゴ回転機構	モータ駆動 (Max. 10rpm)	
ルツボ蓋用シャッター機構	手動 (ルツボの蓋を機械的に開閉)	
液温測定用熱電対上下機構	手動 (機械位置から液温測定位置まで移動)	
電力	単相200V 15A	単相200V 20A
排気ダクト径	Φ100 ※筐体内排気用排気設備をご準備下さい	
装置サイズ(筐体)	W750×D650×H1650	
装置重量	180kg	190kg
オプション	微差圧計 シグナルタワー	

